

第 11 回反応性プラズマ国際会議／
第 75 回気体エレクトロニクス会議
(ICRP-11 / GEC 2022)

広告主募集趣意書

ICRP-11 / GEC 2022 組織委員会

**第 11 回反応性プラズマ国際会議／
第 75 回気体エレクトロニクス会議
(略称：ICRP-11 / GEC 2022)
広告主募集趣意書**

1. 会議の名称

和文名 第 11 回反応性プラズマ国際会議／
第 75 回気体エレクトロニクス会議
英文名 11th International Conference on Reactive Plasmas /
75th Annual Gaseous Electronics Conference
略称 ICRP-11 / GEC 2022

2. 主催機関等の名称

- (1) 主催 第 11 回反応性プラズマ国際会議組織委員会
組織委員長 朽久保文嘉
GEC Executive Committee
Chair Julian Schulze
- (2) 共催 公益社団法人 応用物理学会
- (3) 後援 アメリカ物理学会, 第 40 回プラズマプロセッシング研究会,
第 35 回プラズマ材料科学シンポジウム
(一社) スマートプロセス学会, (一社) 静電気学会, (一社) 電気学会,
(一社) 電子情報通信学会, (一社) 日本 MRS, (一社) 日本機械学会,
(一社) 日本物理学会, (一社) 表面技術協会, (一社) プラズマ・核融合学会,
(一社) 溶接学会, (公社) 化学工学会, (公社) 電気化学会,
(公社) 日本化学会, (公社) 日本表面真空学会, 放電学会

3. 開催期間

2022 年 10 月 3 日 (月) ～2022 年 10 月 7 日 (金) の 5 日間

4. 開催場所

仙台国際センター (〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地)

5. 会議開催の目的

反応性プラズマを利用したプラズマプロセスは、薄膜電子デバイスの製造、半導体集積回路の超微細加工、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等に関わる新素材の創製、環境科学等における基盤技術として発展しています。本国際会議は、プラズマプロセスに関連する諸現象を物理・化学的観点から基礎的に解明し、複雑な反応性プラズマを制御する手法を学術的に確立することを主眼とすると共に、これを基にした最先端のプラズマ応用について、国内外の第一線の研究者による講演、研究発表、討議を行います。これにより、この分野の一層の発展を期するとともに、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連

携を強めます。

6. 会議開催の経緯

応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会(1989年度以前はプラズマエレクトロニクス研究会)では、年1回「プラズマプロセッシング研究会(Symposium on Plasma Processing)」を開催しており、2022年1月の研究会で第39回を迎えました。この間、この分野の研究の活発化は世界的に著しく、また、日本の研究レベルも世界の最高水準にあると、国内研究者の重要な発表の場となっております。このような状況下で、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連携を強化し、この分野の研究の進展を一層強化するため、プラズマエレクトロニクス分科会ではプラズマプロセッシング研究会を3年程度に1回、国際会議として開催することとし、これまでに1991年に名古屋以来、横浜(1994)、奈良(1997)、ハワイ(1998)(GECと合同)、フランス(2002)(ESCAMPIGと合同)、宮城松島(2006)パリ(2010)(GECと合同)、福岡(2014)、ハワイ(2015)(GECと合同)、札幌(2019)(ICPIGと合同)計10回の国際会議を成功裏に開催してきております。今回はその第11回目として、参加者数550名以上(うち海外から200名以上)を目標に、仙台市での開催に向けて準備を進めてきております。

7. 会議計画の概要

(1) 会議の構成

招待講演		約60	(うち国内)	約15)
一般講演	口頭発表	約240	(うち国内)	約150)
	ポスター	約250	(うち国内)	約150)
セッション数		19		

(2) 主要題目

一般セッション

1. Atomic & molecular process

- 1.00. Atomic and molecular collisional and dynamical processes
- 1.01. Electron and photon collisions with atoms and molecules: excitation
- 1.02. Electron and photon collisions with atoms and molecules: ionization
- 1.03. Heavy-particle collisions
- 1.04. Dissociation, recombination and attachment
- 1.05. Distribution functions and transport coefficients for electrons and ions
- 1.06. Other atomic and molecular collision phenomena

2. Plasma science

- 2.01. Nonequilibrium kinetics of low-temperature plasmas
- 2.02. Basic plasma physics phenomena in low-temperature plasmas
- 2.03. Plasma boundaries: sheaths, boundary layers, others
- 2.04. Plasma-surface interactions
- 2.05. Plasma diagnostic techniques
- 2.06. Modeling and simulation: computational methods
- 2.07. Modeling and simulation: validation and verification
- 2.08. Modeling and simulation: plasma sources

- 2.09. Modeling and simulation: chemical reactions
- 2.10. Modeling and simulation: other
- 2.11. Glows: dc, pulsed, microwave, others
- 2.12. Capacitively coupled plasmas
- 2.13. Inductively coupled plasmas
- 2.14. Magnetically-enhanced plasmas: ECR, helicon, magnetron, others
- 2.15. Atmospheric and high pressure plasmas: jets and gliding arcs
- 2.16. Atmospheric and high pressure plasmas: dielectric barrier and corona discharges
- 2.17. Atmospheric and high pressure plasmas: catalysis and chemical conversion
- 2.18. Thermal plasmas: arcs, jets, switches, others
- 2.19. Plasmas in liquids
- 2.20. Plasma on or contacting liquids
- 2.21. Plasmas and aerosols
- 2.22. Negative-ion and dust-particle-containing plasmas
- 2.23. Gas phase plasma chemistry
- 2.24. Other plasma science topics
- 3. Plasma applications
 - 3.01. Plasmas for light production: laser media, glows, arcs, flat panels, and novel sources
 - 3.02. Plasma etching
 - 3.03. Plasma deposition
 - 3.04. Plasma ion implantation
 - 3.05. Green plasma technologies: environmental and energy applications
 - 3.06. Plasma processing for photovoltaic applications
 - 3.07. Biological, medical, and agricultural applications of plasmas
 - 3.08. Plasma propulsion and aerodynamics
 - 3.09. Plasmas for nanotechnologies, flexible electronics, and other emerging applications
 - 3.10. Plasma for other materials processing and synthesis

特別企画ワークショップ

- (i) Industrial plasma technologies
- (ii) Plasma physics for space propulsion technologies
- (iii) Functional surfaces in plasma elementary and process-applicable reactions
- (iv) Catalytic effects in plasma-liquid interaction

8. 委員名簿（アルファベット順で記載）

◇国際組織委員会（International Organizing Committee）

委員長	朽久保 文嘉	東京都立大学	Japan
副委員長	W. Choe	KAIST	Korea
副委員長	E. Stamate	Technical University of Denmark	Denmark
	N. Babaeva	Joint Institute for High Temperatures	Russia
	A. Bourdon	École Polytechnique	France

K. Hensel	Comenius University	Slovakia
平松 美根男	名城大学	Japan
石川 健治	名古屋大学	Japan
金子 俊郎	東北大学	Japan
J. Kenney	Applied Materials	USA
熊田 亜紀子	東京大学	Japan
栗原 一彰	KIOXIA	Japan
H. J. Lee	Pusan National University	Korea
D. Liu	Xi'an Jiaotong University	China
村上 泉	核融合科学研究所	Japan
S. Nijdam	Eindhoven University of Technology	The Netherlands
D. O'Connell	Dublin City University	Ireland
太田 貴之	名城大学	Japan
酒井 道	滋賀県立大学	Japan
千徳 靖彦	大阪大学	Japan
節原 裕一	大阪大学	Japan
M.-J. Wang	National Taiwan University of Science and Technology	Taiwan
渡邊 隆行	九州大学	Japan
R. White	James Cook University	Australia
米田 仁紀	電気通信大学	Japan

◇諮問委員会 (Advisory Committee)

U. Czarnetzki	Ruhr-Universität Bochum	Germany
A. Fridman	Drexel University	USA
堀 勝	名古屋大学	Japan
Y.-K. Pu	Tsinghua University	China
白谷 正治	九州大学	Japan
豊田 浩孝	名古屋大学	Japan

◇プログラム委員会 (Program Committee)

委員長	酒井 道	滋賀県立大学	Japan
	伊藤 淳	核融合科学研究所	Japan
	伊藤 剛仁	東京大学	Japan
	鎌滝 晋礼	九州大学	Japan
	J. Kenney	Applied Materials	USA
	栗原 一彰	KIOXIA	Japan
	D. Liu	Xi'an Jiaotong University	China
	村上 泉	核融合科学研究所	Japan
	D. O'Connell	Dublin City University	Ireland
	太田 貴之	名城大学	Japan
	佐々木 浩一	北海道大学	Japan
	E. Stamate	Technical University of Denmark	Denmark

高橋 和貴	東北大学	Japan
田中 宏昌	名古屋大学	Japan
田中 康規	金沢大学	Japan
富田 健太郎	北海道大学	Japan

◇出版委員会 (Publication Committee)

委員長	太田 貴之	名城大学	Japan
	栗原 一彰	KIOXIA	Japan
	布村 正太	産業技術総合研究所	Japan

◇現地組織委員会 (Local Organizing Committee)

委員長	金子 俊郎	東北大学	大学院工学研究科
	安藤 晃	東北大学	大学院工学研究科
	佐藤 岳彦	東北大学	流体科学研究所
	大西 直文	東北大学	大学院工学研究科
	茂田 正哉	東北大学	大学院工学研究科
	加藤 俊顕	東北大学	大学院工学研究科
	高橋 和貴	東北大学	大学院工学研究科
	岡田 健	東北大学	大学院工学研究科
	高奈 秀匡	東北大学	流体科学研究所
	高島 圭介	東北大学	大学院工学研究科
	佐々木 渉太	東北大学	大学院工学研究科
	杉本 真	東北大学	大学院工学研究科
	石川 健治	名古屋大学	低温プラズマ科学研究センター
	古免 久弥	大阪大学	接合科学研究所

(一部依頼中を含む)

9. プロシーディングス広告主募集

第 11 回反応性プラズマ国際会議では、会議開催当日プロシーディングスを発行しております。今回はアメリカ物理学会主催の第 75 回気体エレクトロニクス会議との合同開催であります。これまでと同様にプロシーディングスに広告を掲載することになりました。下記要領によって、広告主を募集致したいと存じますので、上記、国際会議の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

【募集要項】

- (1) 書名：「第 11 回反応性プラズマ国際会議／第 75 回気体エレクトロニクス会議」
プロシーディングス
- (2) 出版元：応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会
- (3) 体裁：PDF 形式 (A4 サイズ, 横組み, 本文一色)
- (4) 発行月日：令和 4 年 1 0 月 3 日
- (5) 掲載料：1 0 0, 0 0 0 円 (A 4 版 1 頁)
1 0 0, 0 0 0 円 (A 4 版 1 / 2 頁, プログラム目次ページ挿入)
- (6) 掲載原稿締切：令和 4 年 8 月 3 1 日
- (7) 入稿 (データ) 形式
 - ・サイズ：A4 1 ページ：ヨコ 210mm×タテ 297mm 以内
A4 半ページ：ヨコ 210mm×タテ 148.5mm 以内
 - ※微調整させていただくこともあります。
 - ・入稿 (データ) 形式：完全版下電子データで、Adobe Illustrator で制作したアウトライン済みの EPS データ、画像データをご使用の場合は、その画像も添付してください (画像解像度は 350dpi 以上の CMYK のデータ)。すべてのデータについて出力見本をご用意ください。また、フィルム・紙焼き・清刷でも受け付けは可能です。
 - ・広告原稿送付方法：データを E-mail にてお送りください。

10. プロシーディングス広告主申込書

別紙として添付しております。

11. 送金先 (銀行振り込みでお願いします)

七十七銀行 八幡町支店 普通預金口座

口座番号：5 0 3 6 8 2 6

名 義：ICRP-11 会計株式会社センキョウ 代表取締役 長谷川 竹志
(アイシーアールピージュウイチカイケイ (カ センキョウ))

12. 申し込み先

ICRP-11 / GEC 2022 運営事務局

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-4-2

株式会社 センキョウ内

TEL: 022-236-7161 FAX: 022-236-7163 E-mail: icrp11@senkyo.co.jp